

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成19年2月1日(2007.2.1)

【公開番号】特開2005-332803(P2005-332803A)

【公開日】平成17年12月2日(2005.12.2)

【年通号数】公開・登録公報2005-047

【出願番号】特願2005-57445(P2005-57445)

【国際特許分類】

H 05 B 33/10 (2006.01)

H 05 B 33/04 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 05 B 33/10

H 05 B 33/04

H 05 B 33/14

A

【手続補正書】

【提出日】平成18年12月11日(2006.12.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板に配置されている下部電極に有機導電層を形成する有機導電層形成工程と、前記有機導電層形成工程の後に上部電極を形成する上部電極形成工程と、前記上部電極形成工程の後にパッシベーション層を形成するパッシベーション層形成工程とを有する有機電子素子の製造方法において、

前記上部電極形成工程における前記基板の被処理面は下向きに保持され、

前記パッシベーション層形成工程における前記基板の被処理面は上向きに保持されることを特徴とする有機電子素子の製造方法。

【請求項2】

前記上部電極形成工程は透明電極材料をスパッタすることで前記上部電極を形成する工程であることを特徴とする請求項1に記載の有機電子素子の製造方法。

【請求項3】

前記パッシベーション層形成工程はCVD法により前記パッシベーション層を形成する工程であることを特徴とする請求項1に記載の有機電子素子の製造方法。

【請求項4】

前記パッシベーション層形成工程において前記基板は載置台に載置されることを特徴とする請求項1に記載の有機電子素子の製造方法。

【請求項5】

前記基板は前記上部電極形成工程から前記パッシベーション層形成工程まで外気に曝されずに処理されることを特徴とする請求項1に記載の有機電子素子の製造方法。

【請求項6】

請求項1に記載の前記有機電子素子は有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【請求項7】

基板に配置されている下部電極に有機導電層を形成する有機導電層形成手段と、上部電極を形成する上部電極形成手段と、パッシベーション層を形成するパッシベーション層形

成手段とを有する有機電子素子の製造装置において、

前記上部電極形成手段は前記基板の被処理面を下向きに保持する保持手段を有し、

前記パッシベーション層形成手段は前記基板の被処理面を上向きに保持する保持手段を有することを特徴とする有機電子素子の製造装置。

【請求項 8】

前記上部電極形成手段は透明電極材料をスパッタすることで前記上部電極を形成するスパッタ手段を有することを特徴とする請求項 7 に記載の有機電子素子の製造装置。

【請求項 9】

前記パッシベーション層形成手段は CVD で前記パッシベーション層を形成する CVD 手段を有することを特徴とする請求項 7 に記載の有機電子素子の製造装置。

【請求項 10】

前記パッシベーション層形成手段は前記基板を載置する載置台を有することを特徴とする請求項 7 に記載の有機電子素子の製造装置。

【請求項 11】

前記上部電極形成手段と前記パッシベーション層形成手段との間は前記基板を外気に曝さずに搬送される外気遮蔽手段が設けられていることを特徴とする請求項 7 に記載の有機電子素子の製造装置。

【請求項 12】

請求項 7 に記載の前記有機電子素子は有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

また前記パッシベーション層形成工程において前記基板は載置台に載置されることを特徴とする有機電子素子の製造方法を提供する。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0021】

また前記パッシベーション層形成手段は前記基板を載置する載置台を有することを特徴とする有機電子素子の製造装置を提供する。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

また前記有機電子素子は有機エレクトロルミネッセンス素子である。